ArF 液浸スキャナー

# NSR-S625E

Proven Solutions Through Evolution

ミドルクリティカルレイヤー向け

先端半導体製造に最適なArF液浸スキャナー

# ArF液浸スキャナーNSR-S625E

**NSR-S625E**は、実績のある***Streamlign* Platform**を継承したArF液浸スキャナーです。
前機種のNSR-S622Dからスループットを約1.3倍向上させ、稼働安定性を大幅に改善。さらに、高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」を搭載することで、さまざまな半導体の効率的な生産に貢献します。

## Performance

| | |
|---|---|
| 解像度 | ≦ 38 nm |
| NA | 1.35 |
| 露光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1:4 |
| 最大露光範囲 | 26 mm × 33 mm |
| 重ね合わせ精度 | ≦ 2.5 nm (MMO*1) |
| スループット | ≧ 280 wafers/hour (96 shots) |

*1 Mix and Match Overlay：同一機種間の重ね合わせ精度（例 NSR-S625E#1 to S625E#2）

## 主な特長

### ●*Streamlign* Platform

**Stream Alignment**

・「ストレートラインオートフォーカス」により、ウェハ表面上を一気にマッピングし、フォーカス制御精度を向上

・5眼FIAにより生産性を確保しつつアライメント計測数を増やすことが可能

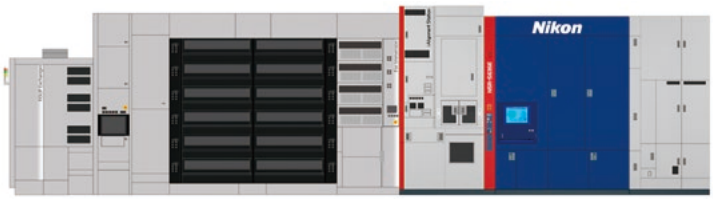
**Bird's Eye Control**

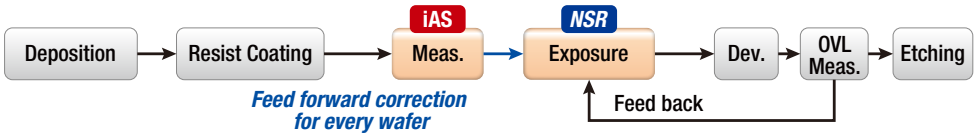
・高精度エンコーダーおよび干渉計のハイブリッドシステムにより、最適なステージパフォーマンスを実現

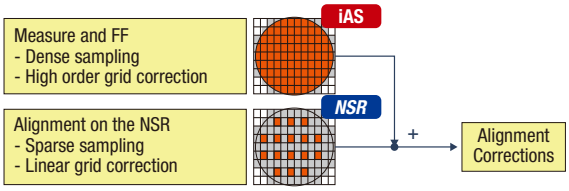
**Modular² Structure**

・モジュール設計による納入、メンテナスの簡易化

### ●高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」




アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品

| | |
|---|---|
| ⚠ 安全に関するご注意 | ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 |

| | |
|---|---|
| ご　注　意 | 本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等（特定技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。 |

●このカタログは2024年2月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。
●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

https://semi.nikon.com/

株式会社 ニコン
精機事業本部 商品戦略部　108-6290　東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟　電話(03)6433-3639

株式会社ニコンテック　140-0012　東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル　電話(03)5762-8911